



بیست و پنجمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و یازدهمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران. ۹-۱۱ بهمن ۱۳۹۷



## طراحی و شبیه سازی نانو حسگر تنظیم پذیر مبتنی بر ساختار جاذب شدید پلازمونیک

عباس حموله علیپور<sup>۱</sup>، علی میر<sup>۱</sup> و علی فرمانی<sup>۱</sup>

<sup>۱</sup>دانشگاه لرستان، دانشکده فنی و مهندسی، گروه الکترونیک

چکیده - در این مقاله، یک نانو حسگر فلز-دی الکتریک-فلز با حساسیت بالا و تنظیم پذیر ارائه شده است. در واقع هدف، پیشنهاد یک نانو حسگر با استفاده از خصوصیت جذب کنندگی شدید است. حساسیت و تنظیم پذیر بودن حسگرهای تمام نوری از پارامترهای مهم در طراحی آنها هستند که در این طرح با استفاده از حل عددی و تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته اند. نتایج نشان می دهد که حسگر پیشنهادی دارای بیشینه حساسیتی برابر با  $693/8 \text{ nm/RIU}$  به ازای تغییرات ضریب شکست دی الکتریک  $n=0/1\Delta$ ، و ضریب شایستگی برابر با  $9/8$  است. همچنین نانو حسگر پیشنهادی می تواند بعنوان کنترل کننده انتشار نور به صورت نور تند و کند عمل کند. با به کارگیری فلز نقره در ساختار حسگر، ضریب افزایش سرعت نور و کاهش آن، به ترتیب  $220$  و  $70$  است.

کلید واژه- جاذب شدید، حسگر، ضریب شایستگی، نور تند و کند.

## Design and Simulation of a Tunable Nano-Sensor based on Plasmonic Perfect Absorber

Abbas Hamooleh Alipour<sup>1</sup>, Ali Mir<sup>1</sup>, and Ali Farmani<sup>1</sup>

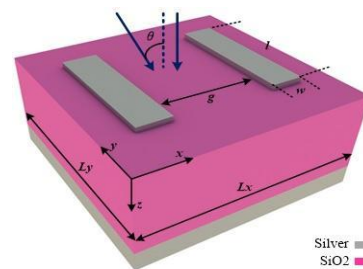
<sup>1</sup> Department of Electrical Engineering, Lorestan University, Khorramabad, Iran

Abstract- In this paper, a highly sensitive and tunable nano-sensor based on metal-dielectric-metal structure is presented. Actually, the goal is to propose a nano-sensor by using perfect absorbing. Sensitivity and tunability of all optical sensors are important parameters in their design, which are investigated by using numerical and analytical methods. Results show that the proposed sensor has Max sensitivity of  $693/8 \text{ nm/RIU}$  with refractive index change of  $\Delta n=0/05$ , and Figure of Merit (FoM) equal to  $9/8$ . Also, the proposed nano-scale sensor can operate as a light propagation controlling with slow and fast light. By using of silver metal in the sensor structure, the fast and slow light coefficient is obtained of  $220$  and  $70$ , respectively.

Keywords: perfect absorber, sensor, figure of merit, slow and fast light.

## ۱- مقدمه

حسگرهای مبتنی بر ساختارهای جاذب پلازمونیک فلز-دی الکتریک-فلز با توجه به گستردگی عملکرد آنها در سامانه‌های مخابرات نوری پیشرفته مورد توجه بسیاری از محققان علم نانو الکترونیک قرار گرفته اند [۱]. جاذب‌ها به طور کلی در دو دسته پهن باند و باند باریک برای کاربردهای مختلف ارائه شده اند. از جمله جاذب‌های باند باریک می‌توان به خنک سازی تابش حرارتی و کاربردهای حسگری همراه با ساخت جاذب مورد نظر اشاره کرد [۲-۳]. حسگرهای پلازمونیک و فوتونیک از دیگر تقسیم‌بندی‌ها محسوب می‌شوند [۴-۵]. ساختارهای پلازمونیک دارای هزینه کمتر، ساخت آسان‌تر و اندازه کوچکتر نسبت به ساختارهای فوتونیک هستند. اخیراً، جاذب‌های پلازمونیک بسیاری براساس ساختار فلز-دی الکتریک-فلز بصورت نظری و عملی با پیکربندی‌های مختلف پیشنهاد شده‌اند. به عنوان مثال، یک جاذب پلازمونیک براساس ساختار فلز-دی الکتریک-فلز در ناحیه طول موج مرئی بیان شده است [۶]. همچنین در [۷]، یک جاذب شدید براساس ساختار چند لایه در ناحیه فرورسرخ به صورت نظری و آزمایشگاهی معرفی گردید. اغلب کارهای پیشنهادی دارای حساسیت پایین هستند که عملکرد حسگر طراحی شده را محدود می‌کند. همچنین بیشتر جاذب‌های شدید تک بانده در حوزه فرکانسی تراهرتز (۰/۱ تا ۱۰) شبیه‌سازی شده اند که با محدودیت افزایش ابعاد ساختار مواجه می‌شوند. اگرچه بررسی جاذب‌های پلازمونیک در ناحیه فرورسرخ مورد مطالعه قرار گرفته اند، اما طراحی یک جاذب شدید از نظر حساسیت بالا و اندازه کوچک کمتر مورد مطالعه قرار گرفته است. بنابراین در این مقاله یک نانو-حسگر حساس و تنظیم پذیر براساس ساختار جاذب پلازمونیک در ناحیه طول موجی فرورسرخ پیشنهاد شده است.



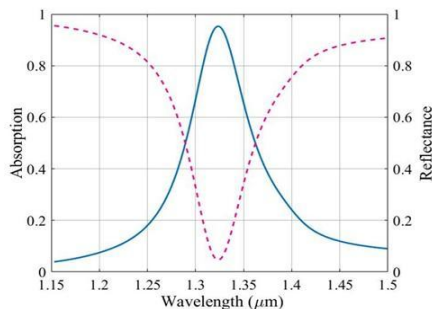
شکل ۱: شمای سه بعدی از پیکربندی سلول واحد نانو حسگر پیشنهادی (nm 700=L<sub>y</sub>=L<sub>x</sub>)

## ۲- ساختار نانو حسگر پیشنهادی

پیکربندی سلول واحد حسگر پیشنهادی به صورت سه بعدی در شکل شماره ۱ نشان داده شده است. ساختار حسگر به صورت سه لایه متشکل از نقره، دی الکتریک (SiO<sub>2</sub>) و نقره است. لایه نقره زمینه دارای ضخامت ۵۰nm با طول و عرض ۷۰۰×۷۰۰nm است. همچنین از دی اکسید سیلیکون (SiO<sub>2</sub>) با ضخامت ۲۵۰nm به عنوان لایه عایق با ثابت دی الکتریک  $\epsilon=2/25$  استفاده شده است. دو نوار فلزی I شکل با ضخامت ۵nm با طول و عرض  $w=100nm$  و  $l=600nm$  که با فاصله  $g=400nm$  از یکدیگر، بر روی سطح عایق قرار دارند. هر کدام از این دو نوار فلزی عمودی، تشکیل یک دوقطبی می دهند. نور به طور عمود بر صفحه نوارها تابش می‌کند و میدان الکتریکی در راستای محور  $x$  نوسان می‌کند. برای تعیین ضرایب جذب و بازتاب باید معادلات ماکسول در ساختار مورد نظر حل شوند. برای این منظور از نرم افزار CST استفاده می‌شود. همانطور که گفته شد فلز مورد استفاده در این طرح نقره است، که ضریب گذردهی با استفاده از مدل درود از دو قسمت حقیقی و موهومی به صورت زیر تشکیل شده است:

$$\begin{aligned} \epsilon(\omega) &= \epsilon_{Re}(\omega) + i\epsilon_{Im}(\omega) \\ &= 1 - \frac{\omega_p^2}{\omega(\omega + i\gamma_c)} = \left(1 - \frac{\omega_p^2}{\omega^2 + \gamma_c^2}\right) + i\left(\frac{\omega_p^2 \gamma_c}{\omega(\omega^2 + \gamma_c^2)}\right) \end{aligned} \quad (1)$$

که در آن  $\omega_p$  بسامد پلاسمای الکتریکی و  $\gamma_c$  بسامد برخورد است. با تابیدن نور ورودی با فرکانس  $\omega$  و زاویه ورودی  $\theta$  به ساختار حسگر، جفت‌شدگی شدید بین نور ورودی و پلاسمون‌های سطحی ساختار ایجاد شده و یک سری از طول موج‌های تحریک شده بین لایه عایق و نقره جذب می‌شوند.



شکل ۲: نمودار طیفی جذب و بازتاب ساختار فلز-دی الکتریک-فلز نانو حسگر پیشنهادی

### ۳ نتایج شبیه سازی و محاسبات

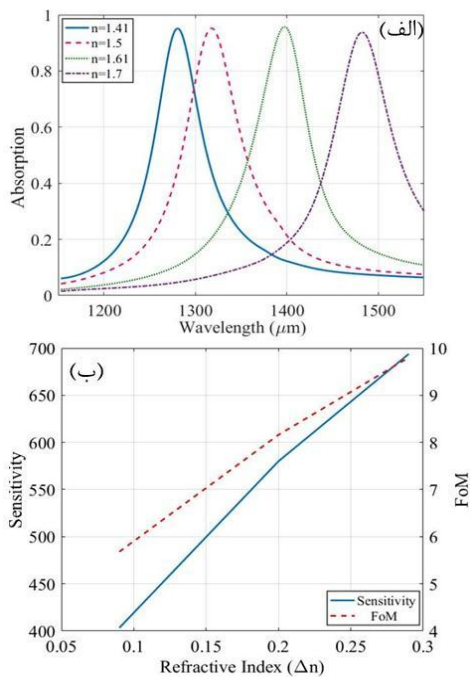
در این بخش از مقاله، عملکرد حسگر پیشنهادی با در نظر گرفتن پارامترهایی از جمله حساسیت، ضریب شایستگی و ضریب کیفیت بررسی شده است. شکل شماره ۴ (الف) نمودار طیفی جذب را به ازای مقادیر مختلف ضریب گذردهی (ضریب شکست) را نشان می‌دهد. همانگونه که از پاسخ طیفی مشاهده می‌شود، با افزایش مقدار ضریب گذردهی دی الکتریک، جابجایی قرمز و با کاهش ضریب شکست دی الکتریک جابجایی آبی برای بسامد تشدید حاصل می‌شود. براساس تغییرات ضریب شکست دی الکتریک حساسیت حسگر بصورت زیر بدست می‌آید:

$$SS = \Delta\lambda / \Delta n \quad (2)$$

که در آن  $\Delta\lambda$  و  $\Delta n$  به ترتیب تغییرات طول موج و تغییرات ضریب شکست مؤثر است. پارامتر مهم در طراحی حسگر ضریب شایستگی است که با به کارگیری رابطه زیر محاسبه می‌شود:

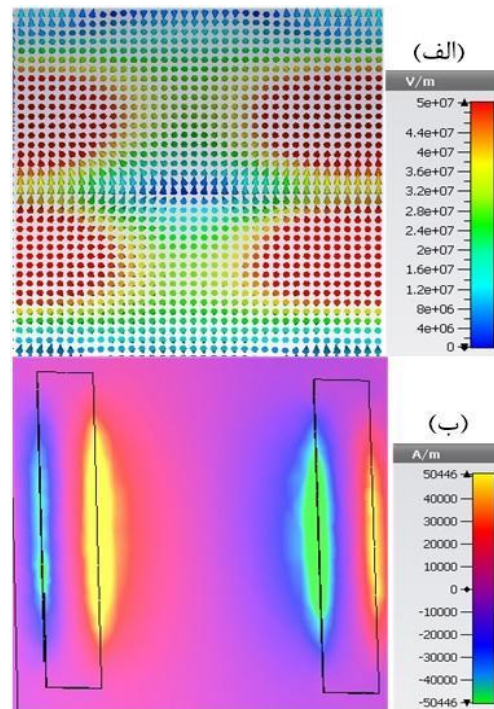
$$FoM = \left[ \left( \frac{\Delta\lambda}{\Delta n} \right) / FWHM \right] = \frac{SS}{FWHM} \quad (3)$$

که در آن  $SS$  حساسیت و  $FWHM$  معادل با عرض کامل در نصف مقدار پیشنهاد است.



شکل ۴: (الف) نمودار طیفی جذب به ازای ضرایب مختلف گذردهی، (ب) نمودار حساسیت و ضریب شایستگی به ازای تغییرات ضریب شکست.

شکل شماره ۲ نمودار طیفی جذب و بازتاب را برای ساختار معرفی شده در بازه طول موجی  $1/15 \mu\text{m}$  تا  $1/5 \mu\text{m}$  نشان می‌دهد. همان‌طور که مشاهده می‌شود، وقتی نوارهای فلزی افقی در معرض تابش نور فرودی خارجی قرار می‌گیرند تشدید شدیدی در نمودار جذب و بازتاب مشاهده به وجود می‌آید که نشانگر جفت شدگی قوی با نور تابش شده از فضای آزاد است. بنابراین نوارهای فلزی می‌توانند بعنوان مد روشن شناخته شوند. شکل ۳ (الف) جریان سطحی برانگیخته در قله جذب  $\omega_0$  را نشان می‌دهد. همان‌گونه که مشاهده می‌شود جریان سطحی مدوری در اطراف دو نوار فلزی I شکل ایجاد شده است. همچنین برای نشان دادن پدیده جذب در بسامد تشدید، توزیع میدان مغناطیسی نانو ساختار بیان شده است. شکل شماره ۳ (ب) توزیع میدان مغناطیسی مماسی را نشان می‌دهد. همان‌گونه که انتظار می‌رود برهمکنش نوارهای فلزی افقی با نور تابشی خارجی بسیار قوی است و باعث بوجود آمدن دوقطبی در نوارهای فلزی می‌شود. این ساختار دارای ضریب جذب بالایی برابر  $0.95$  در بسامد  $226/4 \text{ THz}$  و ضریب کیفیت خوب در حدود  $19$  است.



شکل ۳: (الف) توزیع جریان سطحی برانگیخته (ب) توزیع میدان مغناطیسی مماسی (در بسامد تشدید) ساختار فلز-دی الکتریک-فلز

#### ۴ نتیجه گیری

در این مقاله یک نانو حسگر حساس و تنظیم پذیر در ساختار پلازمونیک فلز-دی الکتریک-فلز بررسی و شبیه سازی شد. طیف های جذب و بازتاب براساس برهمکنش شدید نور فرودی و پلاسمون های سطحی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج محاسبات نشان می دهد که نانو حسگر پیشنهادی در بسامد  $226/4$  THz دارای ضریب جذب  $0/95$  با ضریب کیفیت ۱۹ است. همچنین با تغییر ضریب شکست دی الکتریک نانو حسگر، بیشینه حساسیتی برابر با  $693/8$  و ضریب شایستگی  $9/8$  بدست آمد. علاوه بر این، جذب شدید معرفی شده توانایی استفاده در نور کند و تند را با ضرایب  $70$  و  $220$  داراست.

#### مراجع

- [1] H. Xiong, M-C. Tang, M. Li, D. Li and Y-N. Jiang, "Equivalent Circuit Method Analysis of Graphene-Metamaterial (GM) Absorber," Plasmonics, vol. 13, no. 3, pp. 857-862, 2018.
- [2] L. Meng, D. Zhao, Z. Ruan, Q. Li, Y. Yang and M. Qiu "Optimized grating as an ultra-narrow band absorber or plasmonic sensor," Optics Letters, vol. 39, no. 5, pp. 1137-1140, 2014.
- [3] N. T. Tung, T. Tanaka "Characterizations of an infrared polarization-insensitive metamaterial perfect absorber and its potential in sensing applications," Photonics and Nanostructures – Fundamentals and Applications 28 (2018) 100–105.
- [4] D. Wu, C. Liu, Z. Xu, Y. Liu, Z. Yu, L. Yu, L. Chen, R. Li, R. Ma and H. Ye "The design of ultra-broadband selective near-perfect absorber based on photonic structures to achieve near-ideal daytime radiative cooling," Materials and Design, vol. 139, pp. 104-111, 2018.
- [5] L. N. Le, N. M. Thang, L. M Thuy and N. T. Tung, "Hybrid semiconductor-dielectric metamaterial modulation for switchable bi-directional THz absorbers." Optics Communications vol. 383, pp. 244–249, 2017.
- [6] A. Eshaghian Dorche, S. Abdollahramezani, A. Chizari, and A. Khavasi "Broadband, Polarization-insensitive, and Wide-angle Optical Absorber Based on Fractal Plasmonics," IEEE Photonics Technology Letters, vol. 28, pp. 2545-2548, 2016.
- [7] X. Chen, H. Gong, S. Dai, D. Zhao, Y. Yang, Q. Li, and M. Qiu "Near-infrared broadband absorber with film-coupled multilayer nanorods," Optics Letters, vol. 38, no. 13, pp. 2247-2249, 2013.

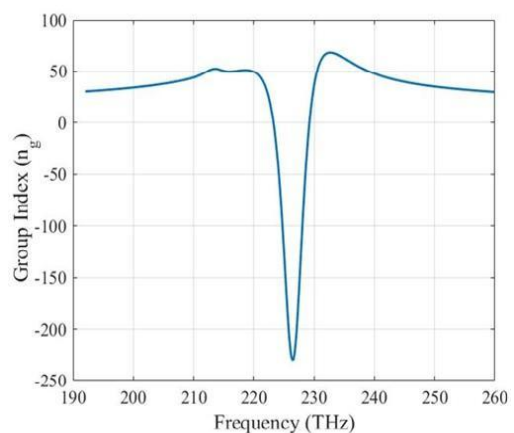
نمودار حساسیت و ضریب شایستگی نانو حسگر طراحی شده براساس تغییرات ضریب شکست در شکل شماره ۴ (ب) نشان داده شده است. یکی دیگر از ویژگی های بسیار کاربردی نانو ساختار پیشنهادی دارا بودن قابلیت کنترل انتشار نور است. برای تحقق این امر با استفاده از پیکربندی حسگر به کاهش و افزایش سرعت گروه می پردازیم. ابتدا سرعت گروه را با استفاده از رابطه زیر محاسبه می کنیم:

$$v_g = C_0 - L/\tau_g \quad (4)$$

که در آن  $C_0$  سرعت گروه در خلأ،  $L$  ضخامت زیر لایه و  $\tau_g$  تأخیر گروه است. سپس با استفاده از رابطه زیر، ضریب گروه،  $n_g$  را تعیین می کنیم:

$$n_g = n + w \frac{dn}{dk} = \left( \frac{dw}{dk} \right)^{-1} = \frac{C_0}{v_g} \quad (5)$$

در رابطه بالا به ازای مقادیر ضریب گروه بالاتر از یک، انتشار نور کند و به ازای ضریب گروه کمتر از یک، انتشار نور تند حاصل می شود. شکل شماره ۵ نمودار ضریب گروه به ازای بسامد را نشان می دهد. همان طور که در شکل مشخص است، ساختار پیشنهادی دارای ضریب نور تند و کندی به ترتیب  $70$  و  $220$  است؛ بدین معنی که سرعت نور را به  $70$  و  $220$  برابر تندتر و کندتر از سرعت نور در خلأ می رساند. این ویژگی مناسب نانو ساختار پیشنهادی، می تواند در سوئیچ های نوری که توسط نور کند کنترل می شوند مورد استفاده قرار گیرد.



شکل ۵: نمودار ضریب گروه ( $n_g$ ) به ازای تغییرات بسامد